

Benutzerdefinierter Ptfе-Korrosionsbeständiger 6-Zoll-Doppelgriff-Fotomasken-Reinigungsblumenkorb-Ständer

Artikelnummer: PL-CP05



Einführung

Hochleistungs-PTFE-Reinigungsständer mit Doppelgriff für 6-Zoll-Fotomasken bieten unübertroffene chemische Beständigkeit für Nassprozesse in der Halbleiter- und Labortechnik. Diese langlebigen Blumenkörbe gewährleisten eine sichere Probenhandhabung, schnelle Entwässerung und kontaminationsfreie Reinigung in aggressiven Säuren und Lösungsmitteln.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter-RCA-Reinigung	Sequentielles Eintauchen von Siliziumwafern in SC-1- und SC-2-Lösungen zur Entfernung von organischen und metallischen Verunreinigungen.	Totale Beständigkeit gegen Oxidationsmittel und heiße Säuren stellt sicher, dass kein Trägerabbau erfolgt.
Fotomasken-Ätzung	Halten von 6-Zoll-Fotomasken während der Entfernung von Chrom oder anderen lichtblockierenden Schichten mit aggressiven Ätzmitteln.	Sichere Positionierung verhindert Maskenvibrationen, sorgt für eine hochwertige Musterübertragung und null Kratzer auf der Oberfläche.
Solarzellen-Texturierung	Prozess der Erstellung von Mikropyramiden auf Siliziumoberflächen unter Verwendung von KOH- oder HF/HNO ₃ -Gemischen zur Verbesserung der Lichtabsorption.	Langlebiges Doppelgriff-Design ermöglicht eine sichere Handhabung in Umgebungen mit hohem Volumen und tiefen Tanks in der Industrie.
MEMS & Mikrofluidik	Reinigung und Ätzung von Glas- oder Siliziumsubstraten, die bei der Herstellung von mikro-elektro-mechanischen Systemen verwendet werden.	Materialreinheit verhindert das Einbringen von Spurenverunreinigungen, die die Funktion von Mikrogeräten stören könnten.
Laborglas für Spurenanalyse	Halten von Bechern, Deckeln oder kleinen Komponenten während der spezialisierten Säuredampfreinigung oder des Einweichens.	Garantierte Abwesenheit von Metallionen (ionenfrei) macht es zum Goldstandard für die Unterstützung der Ultrapurelementanalyse.
Leitfähige Glasvorbereitung	Reinigung von ITO- oder FTO-beschichteten Glassubstraten für die OLED- oder Perowskit-Solarzellenforschung.	Gitterdesign ermöglicht vollständigen Flüssigkeitskontakt mit der leitfähigen Schicht und schützt gleichzeitig die Substratränder.
Nasschemische Entwicklung	Transportieren von belichteten, fotoresistbeschichteten Wafern durch Entwicklerlösungen in Lithografie-Workflows.	Chemische Stabilität über verschiedene organische Entwickler hinweg sorgt für konsistente Ergebnisse und null Materialwechselwirkung.

Parameter	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP05)
Primäres Material	100 % hochreines, neues Polytetrafluorethylen (PTFE)
Substratkompatibilität	Standard 6-Zoll (152,4 mm) Fotomasken, Wafer oder Glas
Griffkonfiguration	Verstärkte Unterstützung mit Doppelgriff für ausgewogenes vertikales Heben
Temperaturbeständigkeit	-200 °C bis +260 °C (-328 °F bis +500 °F)
Chemische Kompatibilität	Universell (Alle Säuren, Basen, organische Lösungsmittel und Piranha-Lösungen)
Steckplatzkonfiguration	Anpassbare Steckplatzbreite, Teilung und Gesamtkapazität (Standard Standard 10/25 Steckplätze)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikationsdetails (Modell: PL-CP05)	
Strukturelle Merkmale	CNC-bearbeitete Gitterbasis für schnelle Entwässerung; abgerundete Probenkontaktstellen	
Oberflächenfinish	Glatte, nicht poröse, bearbeitete PTFE-Oberfläche (Niedrige Reibung)	
Griffhöhe	Anpassbar an spezifische Reinigungstiefen	
Metallgehalt	Null (Metallfreie Konstruktion)	